

表 4.6.2 臺灣 2001 至 2013 年積體電路或半導體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
HFC-23	51	59	59	59	73	91	171
PFC-CF ₄	913	704	752	917	733	875	1,084
PFC-C ₂ F ₆	1,976	3,289	3,348	3,263	1,980	1,974	1,308
PFC-C ₃ F ₈	22	37	37	110	293	321	464
PFC-C ₄ F ₈	22	48	37	37	37	41	77
SF ₆	524	499	513	587	587	695	292
N ₂ O	NE	NE	NE	NE	NE	342	389
NF ₃	202	359	455	587	623	512	590
總計	3,711	4,994	5,199	5,559	4,237	4,850	4,375
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
HFC-23	118	168	164	134	86	169	
PFC-CF ₄	723	398	597	408	266	361	
PFC-C ₂ F ₆	417	189	198	177	84	102	
PFC-C ₃ F ₈	460	476	441	483	141	301	
PFC-C ₄ F ₈	57	63	86	134	201	135	
SF ₆	229	198	239	261	181	213	
N ₂ O	360	333	482	466	558	626	
NF ₃	136	198	156	306	295	687	
總計	2,500	2,298	2,363	2,502	1,812	2,595	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期積體電路或半導體未大量生產，故無追溯調查 1990 至 2000 年排放量。另，N₂O 尚無 IPCC 公告之製程耗用率以及管末處理削減率，故迄今 TSIA 採用保守原則使用量 100% 全部排放申報，世界半導體協會已經開始討論其合宜性，將待其有結論之後配合之。